



675 HFCVD



鑽石沉積反應器系統

- ✓ 能夠在多種材料上合成鑽石膜。
- ✓ 可控制多晶鑽石結構，以生產厚度500奈米至50微米的奈米晶或微晶薄膜。
- ✓ 流線型的腔室框架並簡化設施覆蓋面積。
- ✓ 控制架是獨立的可調式組件，可同時控制最多4個獨立的反應器腔。

系統規格

沉積面積 每一腔室33公分x30公分 (13英寸x12英寸)

電力消耗 每一腔室最高35 kW

氣體控制 3個質量流量控制器 (MFC) 迴路標準：H₂，CH₄，N₂ / 2個額外的氣體迴路可供選擇

壓力控制 工作範圍：6到50托 / 下游閉迴路節流閥控制

燈絲功率 最大30千瓦：200伏特直流電，150安培

接腳鋸盤 腔室外框122公分x82公分 (48英寸x 32英寸)

高度 最高190公分 (74.5英寸)

重量 600公斤 (1320磅)

